

中期経営計画(2011年度～2013年度) の進捗状況

2011年11月8日

日本ゼオン株式会社

代表取締役社長 古河 直純

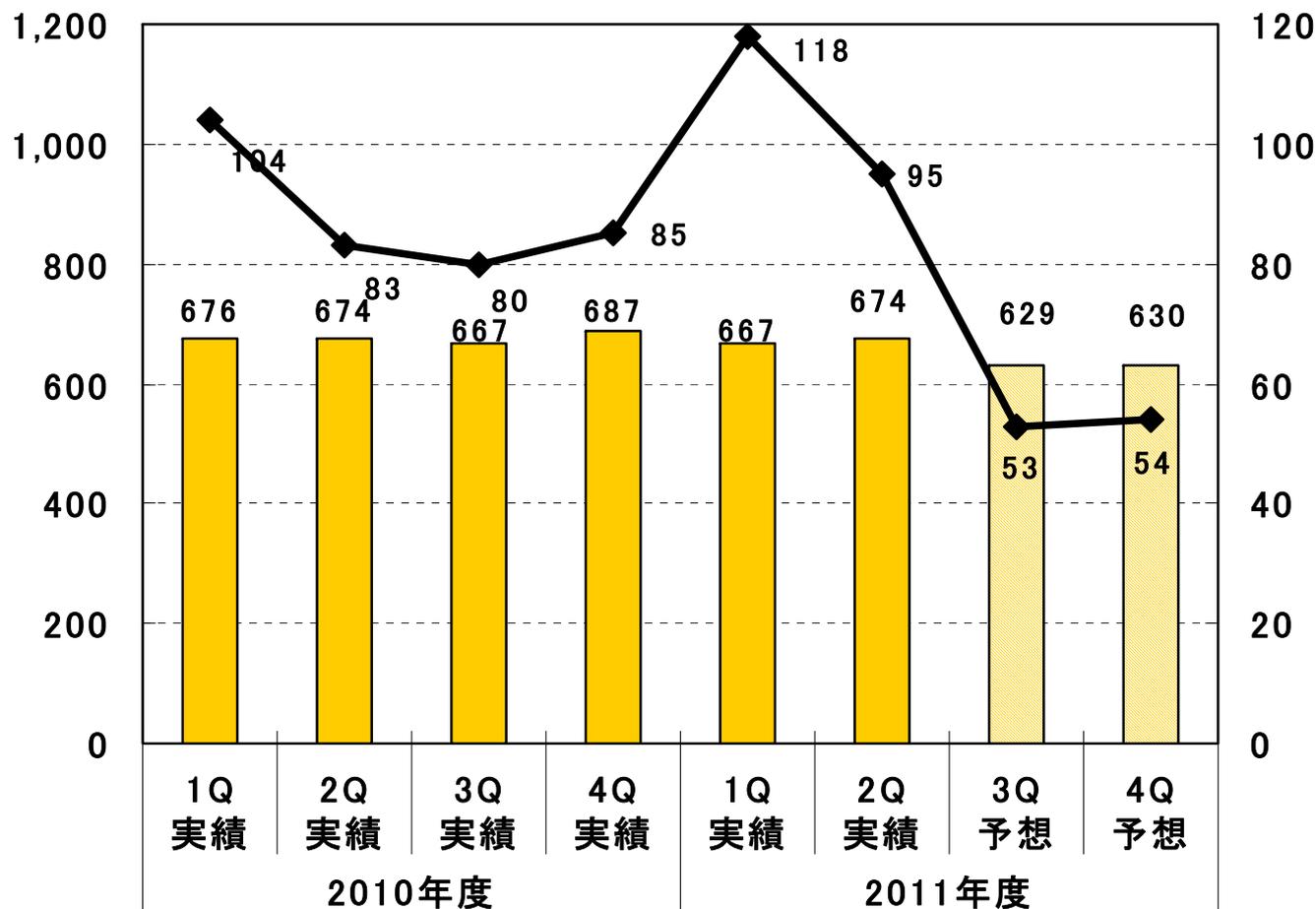
連結業績推移

単位:億円
(売上高)

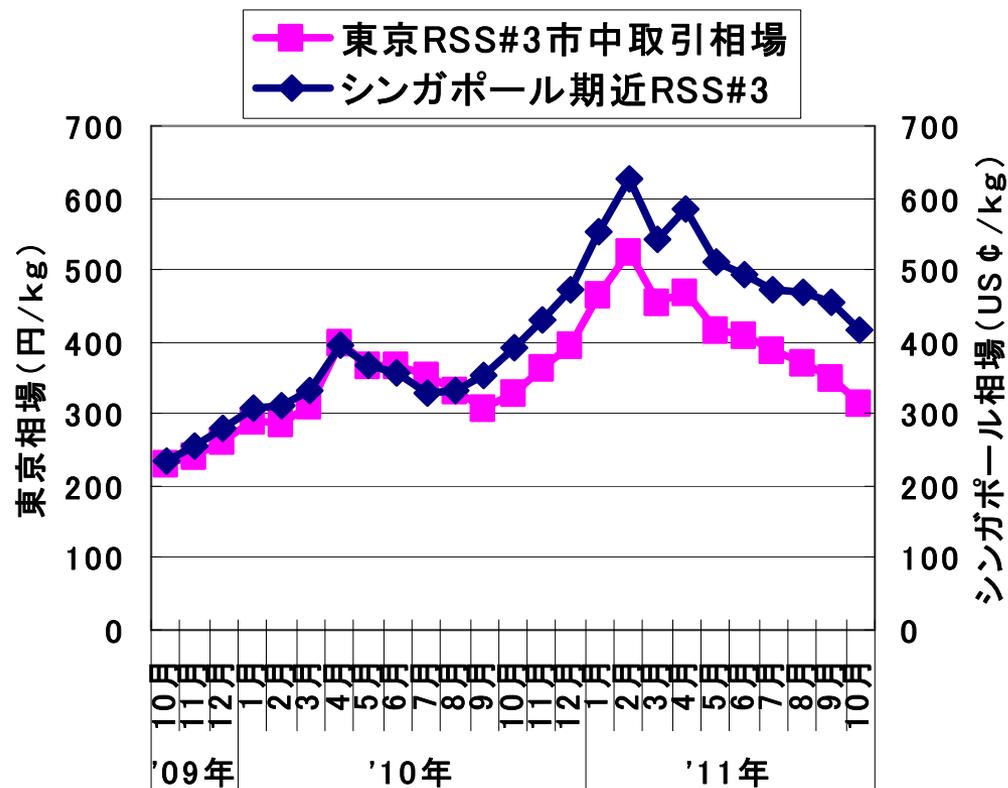
連結業績推移

■ 売上高 ◆ 営業利益

(営業利益)

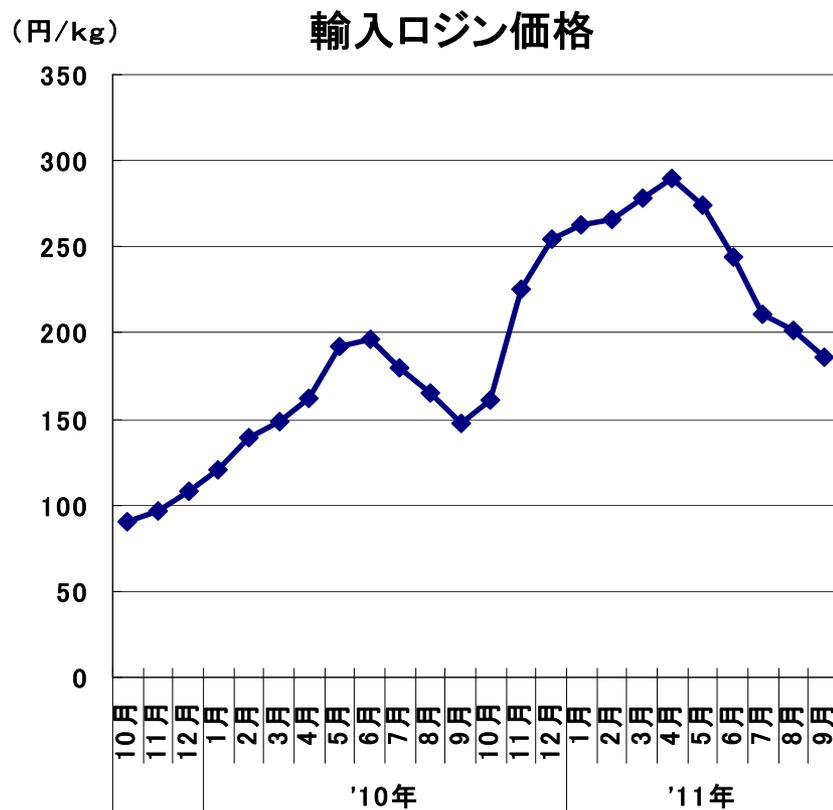


天然ゴム価格推移



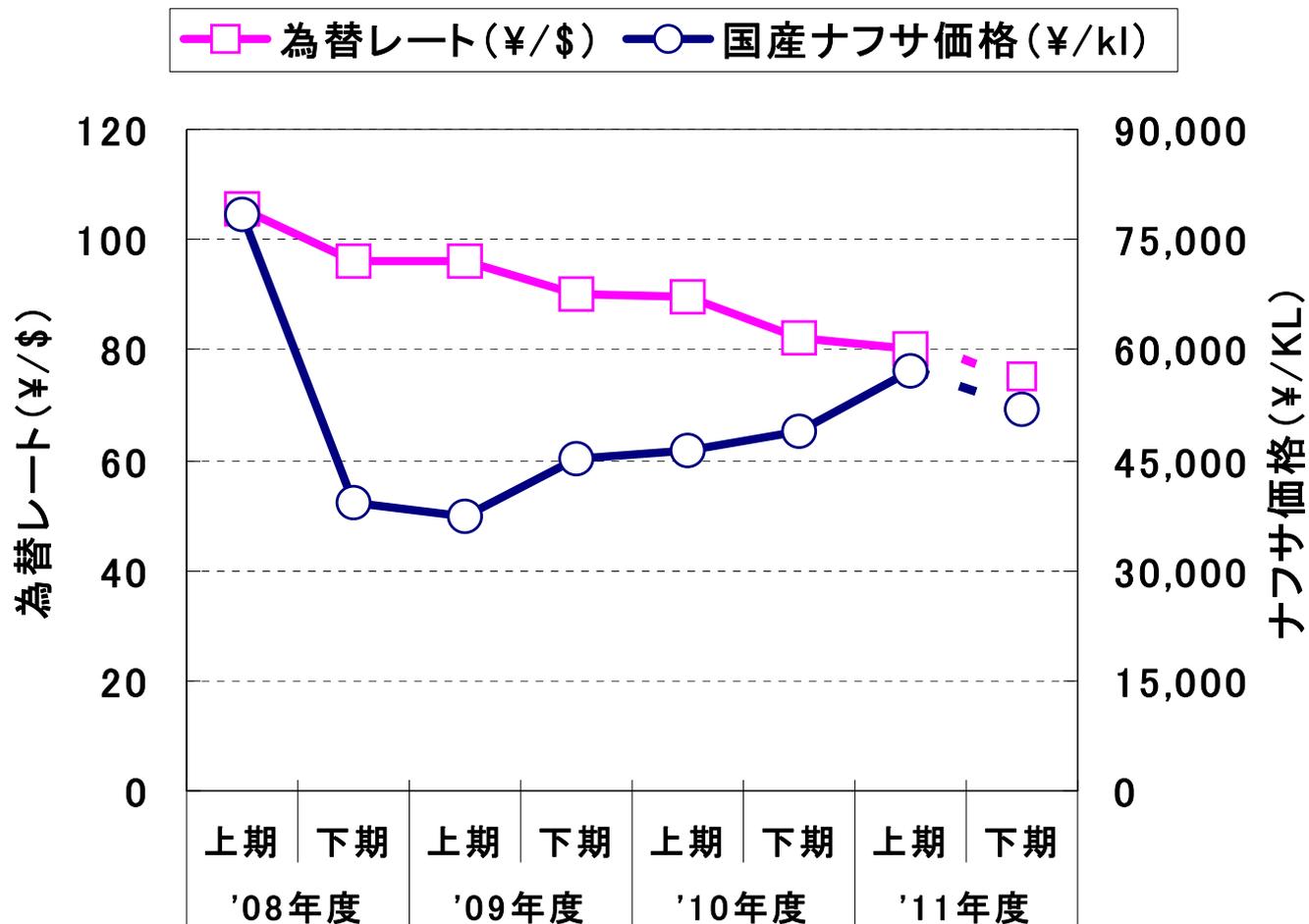
出典: 日本ゴム工業会 月報

ロジン価格推移



出典: 財務省貿易統計

為替レートと国産ナフサ価格推移



※2011年度下期は当社想定

中期経営計画(2011年度～2013年度) 「SZ-20」

2011～2013年度までの
実行計画に展開

重要な
価値観

スピード

対話

社会貢献

大切にする
ゼオンらしさ

-仲間との
相互信頼-

2020年のありたい姿

- 化学の力で
未来を今日にする

ZEON -

わたしたちゼオンは、お客様の夢と
快適な社会の実現に貢献し続けます。

「SZ-20」の事業戦略

エラストマー素材事業と高機能材料事業のそれぞれの強みを磨き上げ、両輪でグローバルに事業を拡大する

2020年度連結売上高5,000億円

2020年海外生産高比率50%以上

事業セグメント別戦略

エラストマー素材事業

成長市場への
グローバルな対応による
強い事業の更なる強化

高機能材料事業

重点3事業分野での
研究開発の加速による
事業拡大

コスト競争力強化

事業セグメント別戦略

エラストマー素材事業

成長市場への
グローバルな対応による
強い事業の更なる強化

高機能材料事業

重点3事業分野での
研究開発の加速による
事業拡大

コスト競争力強化

拡大する低燃費タイヤ市場向けに供給能力を確保する

9月1日、起工式及び祝賀セレモニー開催



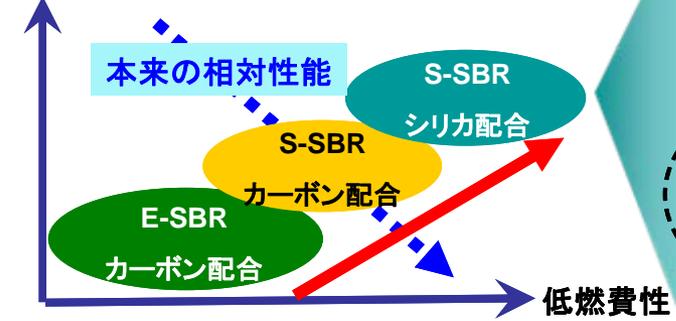
建設立地: ジュロン島
稼動時期: 2013年7月
生産能力: 1期 3~4万mt、
(年産) 2期 3~4万mt
拠点会社: ZEON Chemicals



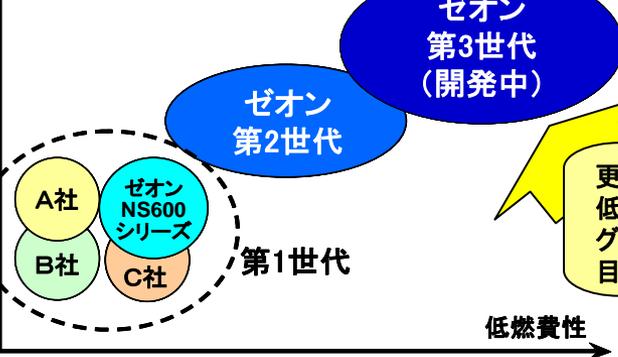
Singapore Pte. Ltd.

◆シリカ配合用変性S-SBR次世代グレード開発を加速

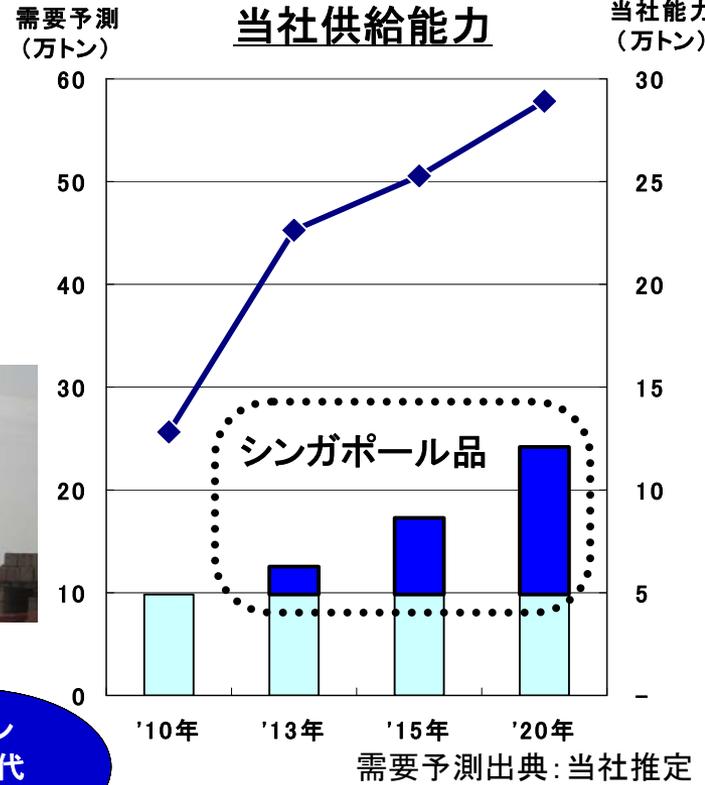
ウェットグリップ性
(安全性)



ウェットグリップ性



低燃費タイヤ用S-SBR需要予測と



更に高次元での
低燃費性と
グリップ性の両立を
目指し開発を加速

自動車材料のグローバル化への対応

新興国市場の拡大

自動車使用年数の長期化

燃料の多様化と寒冷地対応

小排気量過給機によるエンジン温度上昇

◆事業規模の拡大

◆新 Zetpol[®] による高機能化対応

ZCLPテキサス工場
2012年2月:完工予定、
生産能力25%増強

川崎工場 2011年9月:新 Zetpol[®] プラント起工、
2012年9月:完工予定



Zetpol[®] (新 Zetpol[®] の特徴、強み)

川崎工場



- 従来比 2倍のシール寿命
- 従来比 +20°Cシール耐熱性
- バイオ燃料耐性
- 耐油性と耐寒性のバランス向上

成長市場へのグローバルな対応によって、強い事業を更に強化する

中国 PSC(※)材料生産拠点
(2012年4月稼働)

- ・建設立地: 江蘇省常熟市
- ・生産能力(年産): 1期 1~2千mt、
2期 3~4千mt
- ・拠点会社: 瑞翁化成塑料(常熟)有限公司



※ PSC: パウダースラッシュ材料

中国 統括拠点
(2011年9月業務開始)

- ・目的: 事業活動の円滑化、
管理制度の改善、
CSRの充実
- ・所在地: 上海市
- ・拠点会社:
瑞翁(上海)管理有限公司

シンガポール
S-SBR生産拠点
(2013年7月稼働)

ベトナム 加工拠点
(2013年4月稼働)

- 既存生産拠点
- 新設生産拠点
- 既存販売拠点
- 新設販売拠点

事業セグメント別戦略

エラストマー素材事業

成長市場への
グローバルな対応による
強い事業の更なる強化

高機能材料事業

重点3事業分野(※)での
研究開発の加速による
事業拡大

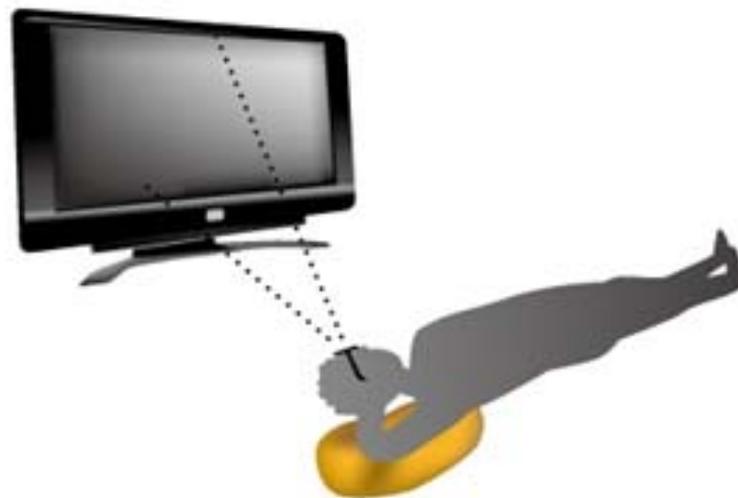
コスト競争力強化

※高機能材料事業の重点3事業分野

… 情報用部材(オプト用・実装用・電子用)、エネルギー用部材、メディカルデバイス

「斜め延伸位相差フィルム」新設備が完成

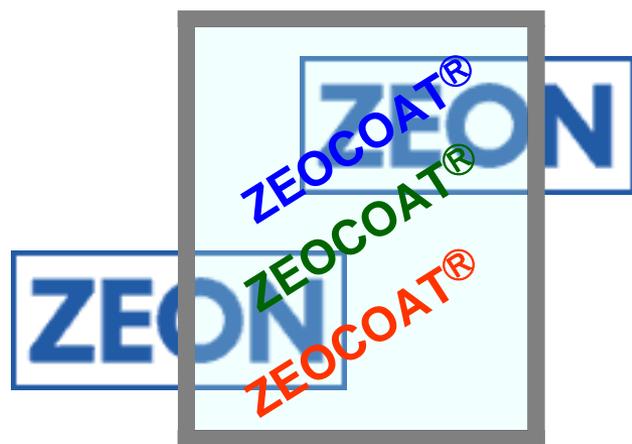
(株)オプテス 富山工場 氷見製造所

斜め延伸フィルムを使った3DTV

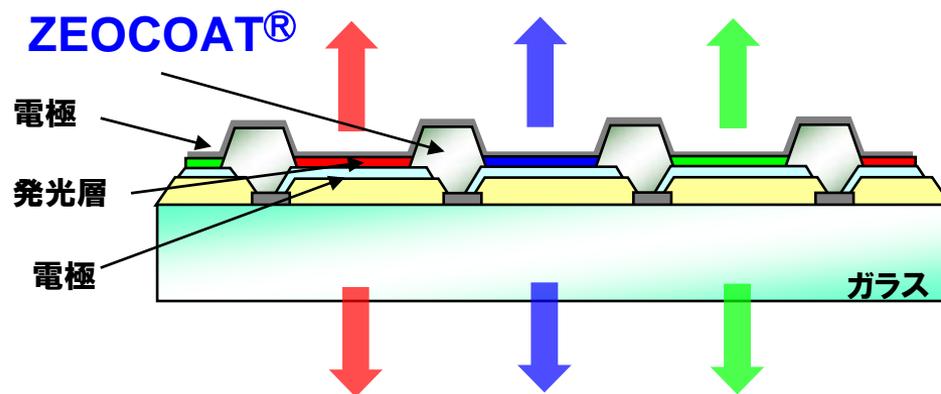
寝ころんで両目が水平でない状態でも、画面が暗くならず、立体映像が認識できる

- ◆2011年10月、大型液晶画面に対応可能な「斜め延伸位相差フィルム」新設備が、(株)オプテス富山工場氷見製造所で完成した。
- ◆今回の新設備稼働で、既存の斜め延伸位相差フィルム設備と合算した生産能力は1,500万m²/年となる。
- ◆3D、有機EL、中小型用のパネル向けに採用が拡大していくと期待している。

当社独自技術で開発した高性能有機絶縁膜ZEOCOAT®が
TDK株式会社が世界で初めて量産を開始したシースルー
有機ELディスプレイ用の画素分離膜として採用



シースルー有機ELディスプレイ
(イメージ図)



有機ELディスプレイ断面図

- ◆有機ELディスプレイ用の画素分離膜に加え、今後、薄膜トランジスタの保護膜への応用も検討中であり、1~2年内の実用化を目指す。
- ◆フィルム基板を用いたフレキシブルディスプレイへの応用を視野に入れて、酸化物半導体や有機半導体の保護膜、層間絶縁膜としての開発を進めている。

米国IBMと共同で開発したエッチングガスの開発成果を AVS 58th International Symposium & Exhibition 2011で 発表しました

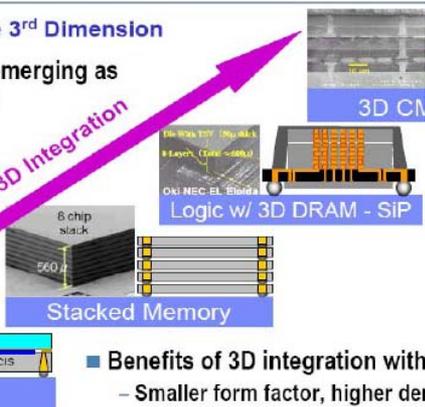
IBM Research | Plasma Processing and Wet Clean Technology | 2011

Evolution of 3D Integration → Through Si Via

Technology Investment in the 3rd Dimension

- Through Silicon Via (TSV) is emerging as a critical enabling technology
- Most major Semiconductor manufacturers are developing TSV - 3DIC capability

Increasing 3D Integration

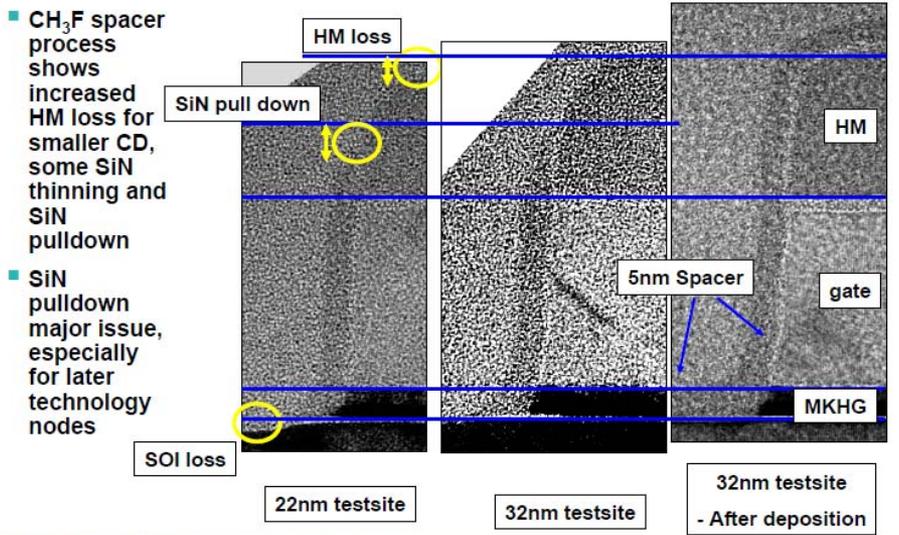


- Benefits of 3D integration with
 - Smaller form factor, higher density
 - Improved performance; higher lower power consumption
 - Potential for lower cost overall

Wire bonded chip stacked 3D
 S. Lässig, 3-D Integration with Through Silicon Vias: An Etch Perspective, Semicon West 2008
 IBM Confidential © 2011

IBM Research | Silicon Science & Process Technology | Plasma Processing

CD dependence of Spacer process – Traditional process

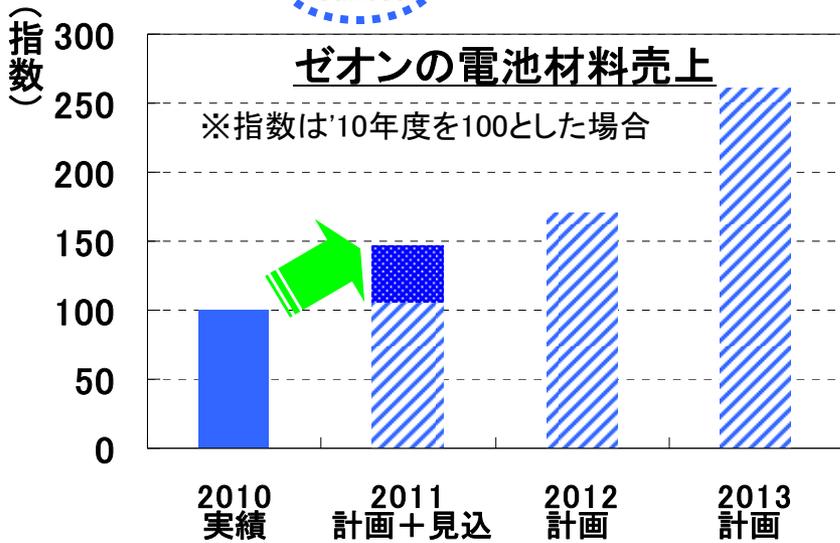
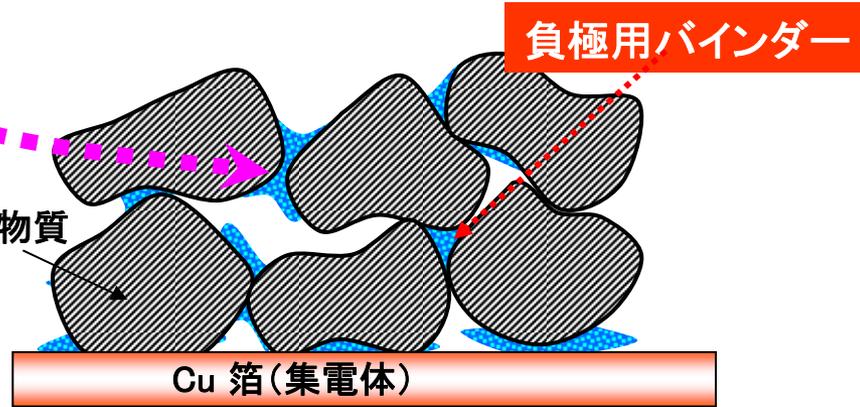
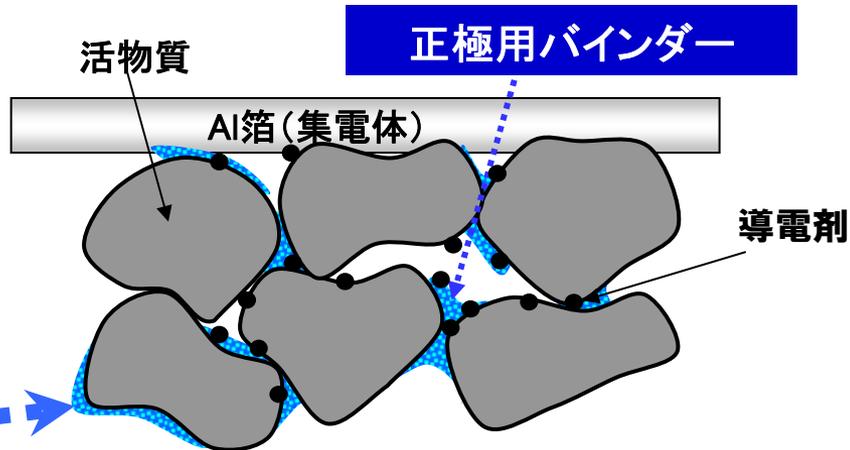
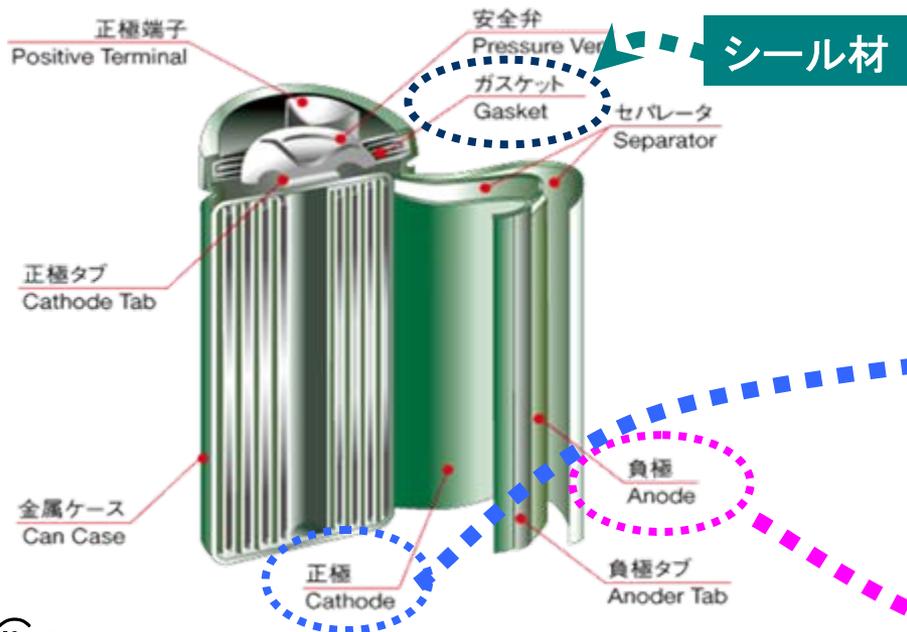


- CH₃F spacer process shows increased HM loss for smaller CD, some SiN thinning and SiN pull down
- SiN pull down major issue, especially for later technology nodes

※ 2011年10月30日から6日間にわたって 米国テネシー州Nashvilleで開催された国際学会。今年で58回の開催を数える。

Unit Process Technology | IBM-Zeon Confidential | August 30th, 2011 © 2011 IBM Corporation

ゼオンのリチウムイオン電池向け製品



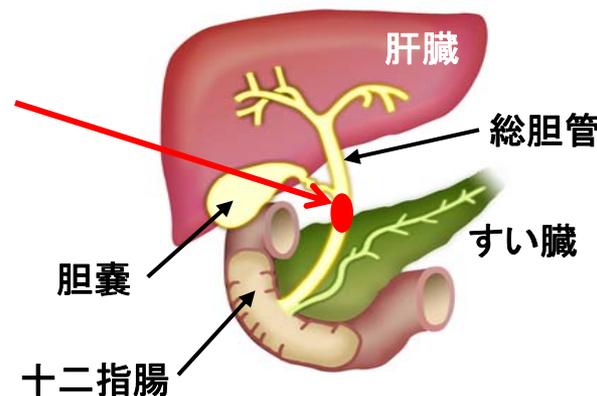
確実な新製品の上市、顧客の拡大で売上高の伸長を図る。

『石採りのゼオン』を目指す

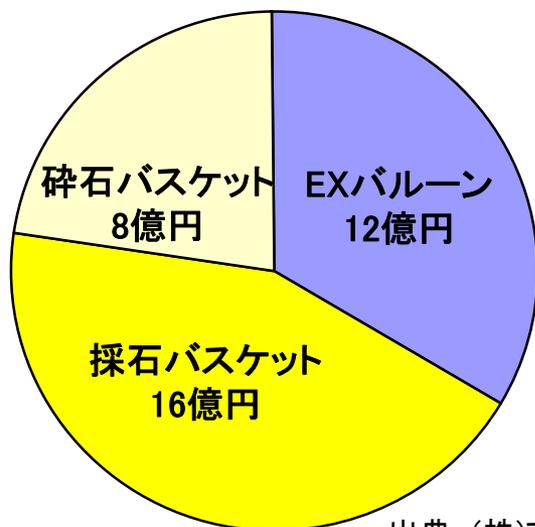
◆ゼオン・クラッシャー及びバスケット・EXバルーンで胆道結石を除去できるデバイスを品揃え

◆結石除去デバイス全体で50%のシェアを目指す

巨大結石から胆泥・胆砂を採り、痛みからの解放

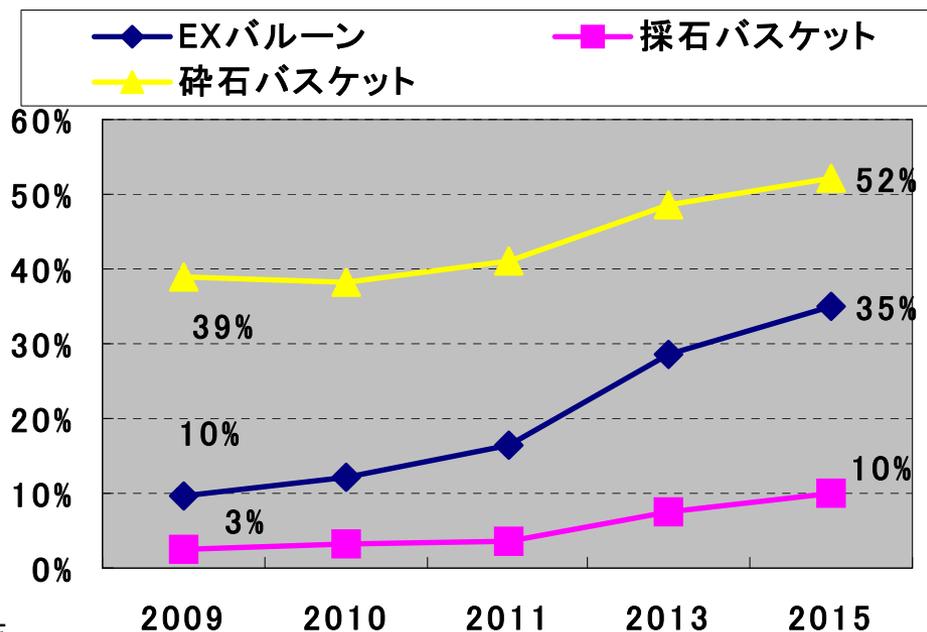


結石除去デバイス 日本市場規模 (2010年度)



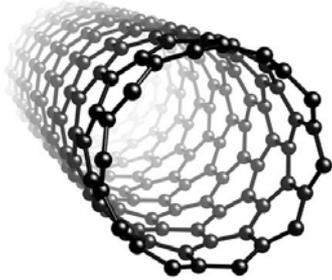
出典: (株)アール アンド ディ
医療機器・用品年鑑 2011年版

結石除去・中期数量シェア目標



産業技術総合研究所(産総研)との共同開発

単層カーボンナノチューブ(CNT)用途開発を加速



CNT用途開発

単層カーボンナノチューブ融合
新材料実用化技術研究組合
(TASC)

理事長：
日本ゼオン(株)取締役社長
古河直純

参加企業

産業技術総合研究所、東レ株式会社、
日本電気株式会社、帝人株式会社、
住友精密工業株式会社
日本ゼオン株式会社

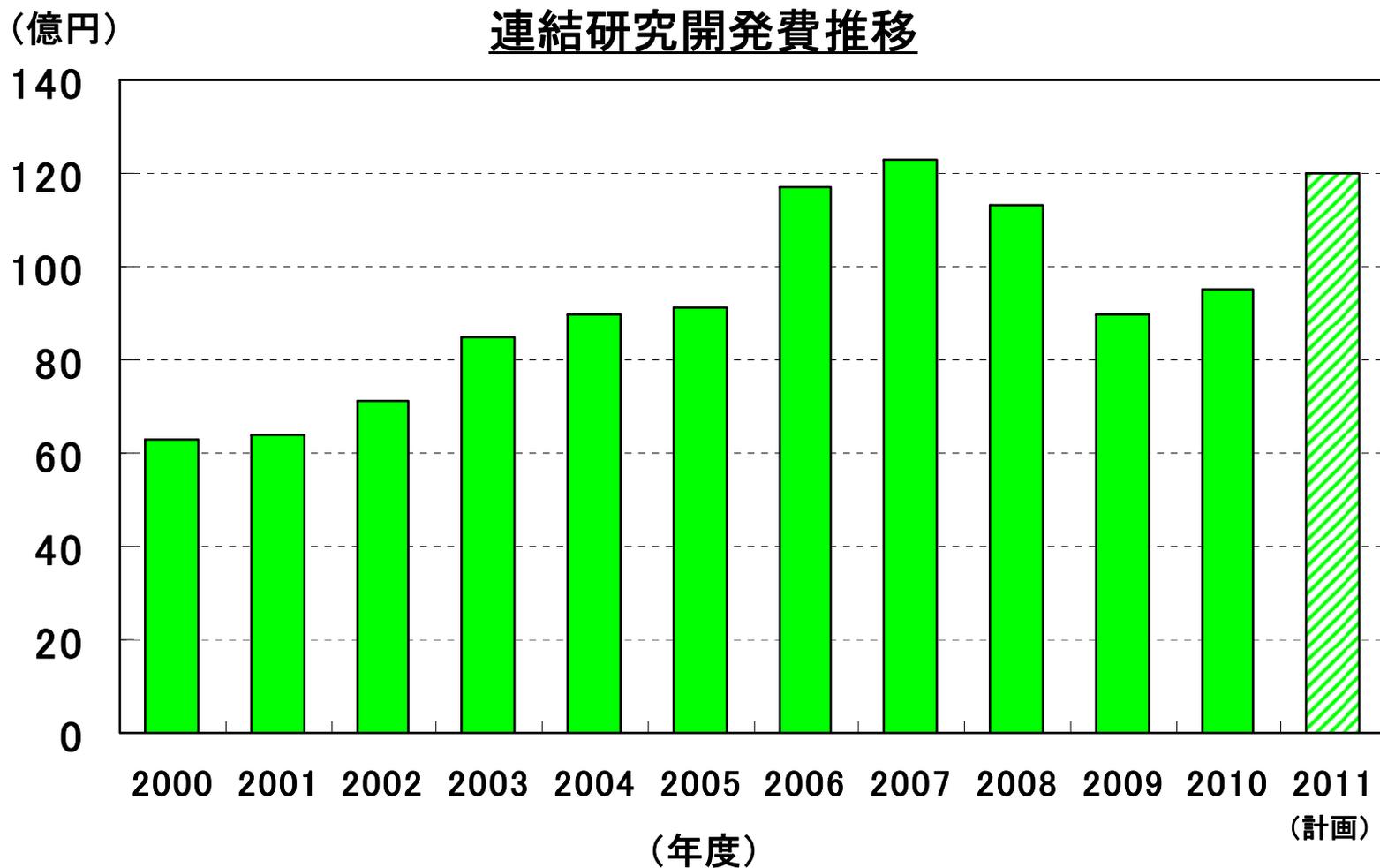
◆2011年10月6日 発表
チタン並みの熱伝導率をもつ
CNT/炭素繊維/ゴム複合材料



(出典:産業技術総合研究所)

◆2011年10月12日 発表
極少量のCNTの添加により、
樹脂・ゴムに導電性を付与

研究開発費の推移



コスト競争力の向上

【生産革新】※

知的生産システム

運転標準化

作業負荷低減・共通言語

風土改革

トップダウン
で推進

ゼオンのコスト競争力強化

ボトムアップ
で活動

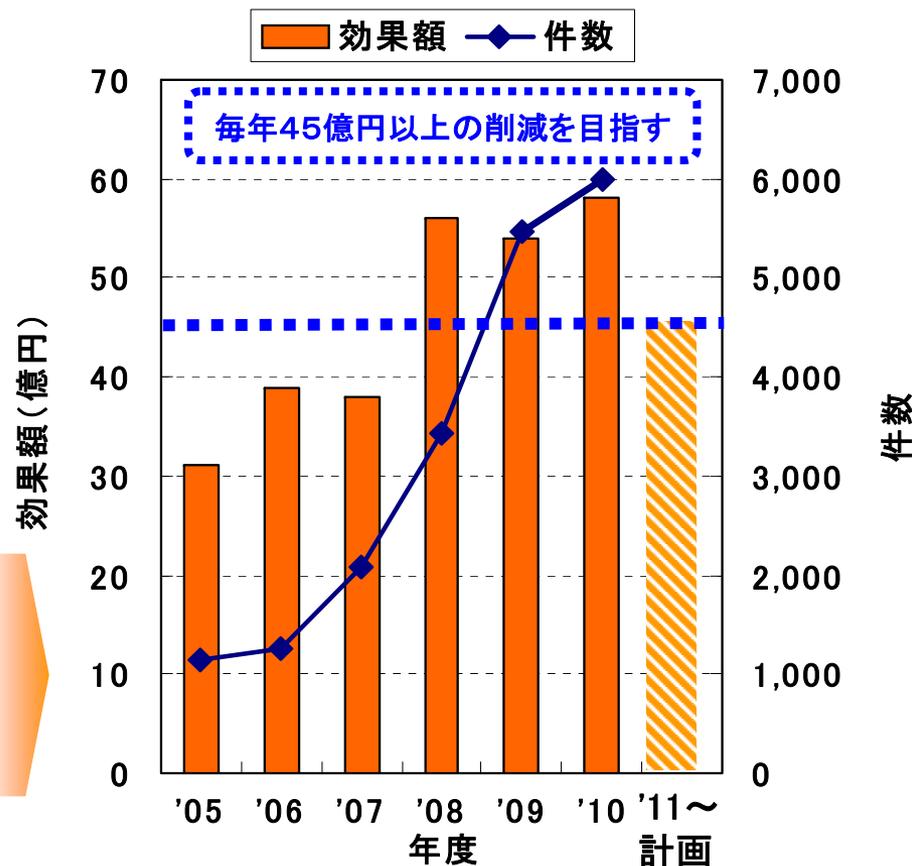
【ZΣ活動】

- ★コストダウンテーマ
- ★サークルテーマ(小集団活動)
- ★コスト意識醸成・教育

テーマ化

革新・改善活動を継続

ZΣ活動 効果額・テーマ件数推移



※生産革新:ダイセル式生産革新手法

スピード

対話

社会貢献

-仲間との相互信頼-

以上

本資料に掲載されている当社の計画、見通しなどは現在入手可能な情報に基づき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は様々な要因により、異なる結果となる場合があります。

日本ゼオン株式会社 CSR統括部門 広報室
東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル
Tel:03-3216-2747, Fax:03-3216-0501